МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

К. т. н. А. П. АЛИЕВА 1 , д. т. н. Ф. К. АЛЕСКЕРОВ, к. ф.-м. н. С. Ш. КАХРАМАНОВ

УДК 621.382.001

Азербайджан, г. Баку, ¹Азербайджанский технический университет, НПО «Селен» НАНА E-mail: almaz46@mail.ru

Дата поступления в редакцию 24.05 2011 г.

МЕЖСЛОЕВЫЕ ПРИМЕСНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ ПОВЕРХНОСТИ (0001) КРИСТАЛЛА ${\rm Bi}_2{\rm Te}_3$, ЛЕГИРОВАННОГО ЦИНКОМ И СЕЛЕНОМ

В процессе роста и кристаллизации легирующих элементов в межслоевом пространстве кристалла образуются нанокомпозиты, вырастающие перпендикулярно базовой плоскости, что приводит к появлению новых электронных свойств кристалла.

В кристаллах $A_2^V B_3^{VI}$ в случае отклонения от стехиометрии за счет избытка халькогена образуются межслоевые нановключения [1—4], которые концентрируются вокруг дефектов и на дислокациях. Легирование кристаллов позволяет получать нанокомпозиты как между слоями сплавов $A_2^V B_3^{VI} <$ примесь>, так и на поверхности кристаллов. Сочетание на микроскопическом уровне металлических и полупроводниковых слоев приводит к появлению новых термоэлектрических и электронных свойств кристаллов [1, 5, 6].

Для достижения желаемых свойств кристаллов необходимо определить оптимальные размеры межслоевых нанообъектов, их ориентацию и взаимное расположение. Исследования следует сосредоточить не только на наноразмерных частицах, структурах и сверхрешетках, но и на объемных нанокомпозитах, включая слоистые кристаллы ${\rm Bi}_2{\rm Te}_3$ с межслоевыми наноразмерными структурами [7].

Получение наноструктурированных систем $A_2^V B_3^{VI}$ < Zn, Se> и изучение механизма межслоевого взаимодействия может открыть путь не только к выявлению в них новых электронных свойств, но и к управлению уровнем Ферми как в объеме, так и в приповерхностном слое, что очень перспективно в свете использования этих материалов в качестве топологических изоляторов [8]. В последнее время идут интенсивные исследования влияния террасоподобных пошаговых поверхностных структур, наноигл и локализации заряда на поведение топологического изолятора на основе халькогенидов Bi и Sb и характеристики поверхностных состояний.

Высокоразрешающие методы микроскопии позволили авторам [8—13] изучить процессы роста и самоорганизации наночастиц примесей в местах обрыва линейных дислокаций в топологических изоляторах $A_2^{\rm V}B_3^{\rm VI}$.

Помимо изучения морфологии поверхности (0001) квинтетов в $A_2^V B_3^{VI}$, также представляет интерес изу-

чение природы химической связи примеси с атомами полуметалла, образующего террасоподобную дефектную плоскость, и «оборванных» связей.

Целью настоящей работы было проведение наноструктрурирования и выявление морфологических особенностей межслоевых поверхностей (0001) $\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Te}_{3}{<}\mathrm{Zn},\mathrm{Se}{>}.$

Наиболее вероятными местами скопления и зарождения нанофрагментов на основе примесей могут быть дефектные центры на поверхности (0001) $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$ [2, 6], линейные и винтовые дислокации, вакансии Те и Ві, и, конечно, межслоевое пространство (Ван-дер-Ваальсовы щели) $\mathrm{Te}^{(1)}$ — $\mathrm{Te}^{(1)}$ кристалла.

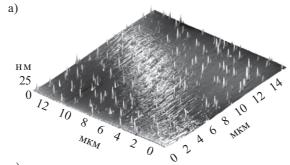
Структура скола базовой поверхности изучалась методом атомно-силовой микроскопии (**ACM**) на микроскопе марки Solver Next. Рентгенодифрактометрические исследования состава материалов проводились на дифрактометре фирмы Philips Panalytical (XRD).

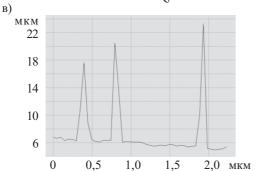
Морфология поверхности (0001) $\rm Bi_2Te_3 < Zn >$ представлена на **рис. 1**. Межслоевые наноструктурные элементы (**MHC**Э) здесь состоят, в основном, из Zn и ZnTe и представляют собой пирамидальные и конусообразные структуры с максимальной высотой 20 нм и размером основания до 150 нм (такие размеры оптимальны для квантовой точки). Изображения других межслоевых нанофрагментов показаны на **рис. 2**.

Были проанализированы трехмерные АСМ-изображения поверхности (0001) Bi₂Te₃<Se>, имеющей ступенчатую форму (рис. 3), в которых заметны структурные элементы разной высоты и площади (нижняя ступень обведена справа). На рисунке видно, что структурные элементы в процессе самоорганизации приобрели особые формы и расположились упорядоченно. Наибольшие «пирамиды роста» имеют размеры 10—15 нм. Большие размеры МНСЭ могут соответствовать местам их самоорганизации в пустотах, соответствующих обрывам краевых дислокаций.

В целом, вне зависимости от примесей, в системе ${\rm Bi_2Te_3}{<}{\rm Zn}$, Se> вырастают структурные элементы следующих типов: нанообъекты, содержащие наночастицы малых размеров (5—10 нм); одиночные элементы размерами от 10 до 20 нм и более, представляющие собой высокие единичные нановыступы, перпендикулярные поверхности (0001) ${\rm Bi_2Te_3}$, МНСЭ с различной плотностью распределения Zn и Se.

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ





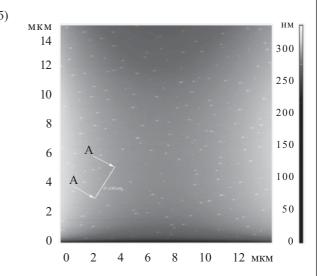
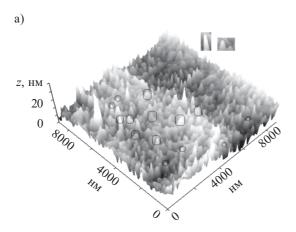


Рис. 1. Трехмерное (*a*) и планарное (*б*) АСМ-изображения нанофрагментов поверхности $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3{<}\mathrm{Zn}{>}$, а также профилограмма распределения примесей по сечению АА (*в*)



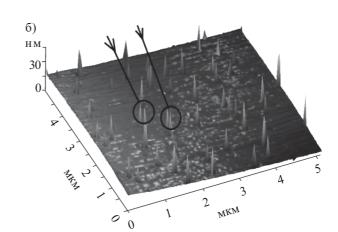


Рис. 2. ACM-изображение фрагментов поверхности $Bi_2Te_3 < Zn > (a)$ и $Bi_2Te_3 < Se > (b)$

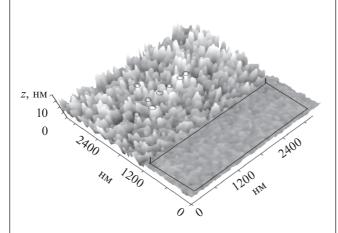
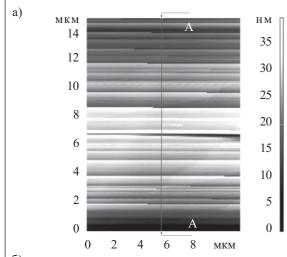


Рис. 3. АСМ-изображение ступенчатой поверхности $Bi_{2}Te_{3}{<}Se{>}$

На рис. 4 показана «гофрированная» область наноступенек, состоящая из сближенных и подобных друг другу геометрических структурных фигур. Здесь видно, что нанообъекты этого класса в трехмерном приближении можно моделировать с помощью единичных наноступенек. Предполагаемые пути диффузии частиц и их агрегации с дальнейшим образованием нанофрагментов, по всей вероятности, связаны с процессом заполнения примесями мест вокруг дислокационных ям и вакансий Те на поверхности (0001) Ві₂Те₃. Начало формирования наноячеек происходит в процессе диффузии примесей вдоль базовой поверхности (0001) межслоевого пространства Те⁽¹⁾—Те⁽¹⁾ и в процессе роста межслоевых элементов с поверхности на вакансиях Те на теллуридных квинтетах.

При взаимодействии и соприкосновении элементов друг с другом образуются поверхности на базисной плоскости (0001), что наглядно отразилось на их топографии. Когда процесс коагуляции достигает сво-





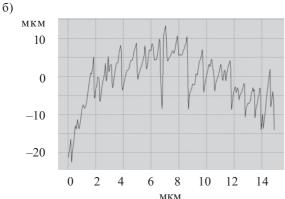


Рис. 4. Двумерное изображение наноступеней в $\text{Bi}_2\text{Te}_3<\text{Se}>(a)$ и фрактальная профилограмма распределения террас в Bi_7Te_3 по сечению AA (δ)

его пика, агрегирующие частицы создают «гофрированные» ступенчатые поверхности.

Из всех дефектов структуры поверхности (0001) Ві Те, которые могут стать центрами зарождения межслоевых наноструктурных элементов, необходимо отметить дислокации, характеризующиеся избыточной энергией упругой деформации. Поскольку Ві₂Те₂ содержит винтовую дислокацию [2], его рост происходит путем присоединения атомов к торцу ступени, оканчивающейся на краевой дислокации. При этом атомные ступени обрываются на концах краевых дислокаций, образуя уширенную структуру высотой около 10 нм. В этих местах могут скапливаться любые примеси, формируя подобные обнаруженным на фотографиях нанообъекты, которые могут образовывать ковалентно-ионные связи с атомами $Te^{(1)}$. Последние оказываются более сильными, чем диполь-дипольные связи Ван-дер-Ваальса [4]. Для слоистого кристалла Ві, Те, <примесь > образование нанофрагментов в пространстве $Te^{(1)}$ — $Te^{(1)}$, приводящее к переходной ковалентно-ионно металлической химической связи, может оказаться чувствительным к зонной структуре. О природе такой химической связи между слоями в сплавах типа Bi₂Te₃<Cu> упоминалось в [11].

Рентгенодифрактограмма поверхности скола кристалла Bi_2Te_3 , легированного Zn, показала рефлексы не только от Bi_2Te_3 , но и от Zn, а также от ZnTe. В

системе ${\rm Bi_2Te_3}{<}{\rm Se}{>}$ заметны рефлексы также от Se и ${\rm Bi_8Se_9}$.

Проведенный анализ может помочь прояснить механизм формирования реального поверхностного слоя, состоящего из террас с высотой ступени, кратной размеру квинтета (Te⁽¹⁾–Bi–Te⁽²⁾–Bi–Te⁽¹⁾) Bi₂Te₃, как предполагается в [10]. Взаимодействие Bi₂Te₃ с электроположительными примесями может привести к пассивированию террасы за счет образования химической связи с висмутом террас и позволит управлять положением уровня Ферми в данных системах [8, 10].

Формирующиеся начальные точки роста нанообъектов, самоорганизуясь, создают основу для описанных МНСЭ, которые далее вырастают перпендикулярно поверхности до «встречи» с такими же элементами с другой стороны теллуридного квинтета плоскости (0001) $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$.

Растущая грань целиком состоит из межслоевых наноструктурных элементов (см. рис. 1—3). Склоны с острыми пирамидами отклонены от грани на определенные углы, что характерно для вициналов [3].

Однако здесь может возникнуть вопрос о существовании относительно простой ориентации плоскостей (0001) $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$ и Zn, т. е. возможны ли ориентационные соотношения, когда плоскости Zn параллельны базовой плоскости (0001) $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$.

Следовательно, формирование на межслоевой поверхности (0001) Bi_2Te_3 <Zn, Se> наночастиц можно рассматривать как эволюционный процесс, стадии которого развиваются в следующей последовательности:

- переход наночастиц из внутрислоевых квинтетов в межслои;
- химическое взаимодействие внедренных атомов примеси с окончаниями винтовых дислокаций $\mathrm{Bi}_{2}\mathrm{Te}_{3};$
- выстраивание пирамид различной размерности с общей фрактальной картиной распределения в Вандер-Ваальсовых щелях.

Особенностью таких процессов является то, что МНСЭ формируются путем последовательных физико-химических превращений, сопровождающихся изменением их состава и возникновением поверхностей между слоями $Te^{(1)}$ — $Te^{(1)}$.

Природа самоорганизации нанообъектов из Zn и Se в $\mathrm{Bi_2Te_3}$ одна и та же. Формирующиеся в межслоях нанокомпозиты, уменьшая теплопроводность $\mathrm{Bi_2Te_3}$ и его твердого раствора ($\mathrm{Bi_2Te_3}$ – $\mathrm{Bi_2Se_3}$), увеличивают термоэлектрическую эффективность кристалла.

Выводы

Проведенные исследования показали, что при легировании слоистых кристаллов нанофрагменты из цинка и селена формируются в режиме ступенчатослоевого роста в направлении базисной поверхности. Высота ступенек и углублений колеблется от 10 до 20 нм, а латеральные размеры — до 50 нм.

Образуемые нанокомпозиты представляют собой «лес» отдельных «усов» — массив квантовых точек, прорастающих из плоскости (0001) $\mathrm{Bi_2Te_3}$ <Zn, Se>. В более крупном масштабе они формируются в террасоподобные ступени, способные генерировать со-

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

- 1. Aleskerov F. K., Kakhramanov S. Sh. The peculiarities of thermoelectric properties of bismuth telluride with iron // Fizika.—Institute of Physics of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2009.—Vol. XV, N 3.— P. 70—75.
- 2. Гольцман Б. М., Кудинов В. А., Смиронов И. А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе $\mathrm{Bi}_2\mathrm{Te}_3$.— М.: Наука, 1972. [Goltsman B. M. Moscow. Nauka. 1972]
- 3. Лемлейн Г. Г. Морфология и генезис кристаллов.— М.: Наука, 1973. [Lemlein G. G. Moscow. Nauka. 1973]
- 4. Коржуев М. А. Механические свойства монокристаллов Bi₂Te₃<Cu>> вблизи *p*-*n*-перехода // Физика твердого тела.— 1996.— Т. 38, № 3.— С. 883—888. [Korzhuev M. A. // Fizika tverdogo tela. 1996. Vol. 38. N 3. P. 883]
- 5. Devillard P., Stanley H. E., First-order branching in diffusion limited aggregation // Physical Review. A.—1987.— Vol. 36, N 11.—P. 5359
- 6. Шевельков А. В. Химические аспекты создания термоэлектрических материалов // Успехи химии РАН.— 2008.— Вып. 77.— С. 3. [Shevelkov A. V. // Uspekhi Khimii RAN. 2008. N. 77. P. 3]
- 7. Пшенай-Северин Д. А., Равич Ю. Н., Ведерников М. В. Искусственно анизотропный термоэлектрический материал с полупрводниковыми и сверхпроводящими слоями // Физика и техника полупроводников.— 2000.— Т. 34.— Вып. 10.— С. 1265—1269. [Pshenai-Severin D. A. // Fizika i Tekhnika poluprovodnikov. 2000. Vol. 34. N 10. P. 1265]

- 8. Winiarz Sz., Czajka R., Suto S. et al. STM and STS investigations of Bi, Te, surface // Acta Physica A.—2003.— Vol. 104, N 3–4.— P. 389.
- 9. Байзер М. В., Витунин В. Ю., Закурдаев И. В., Руденко А. И. Фасетирование поверхности арсенида галлия, близкой по ориентации к (100), в условиях неравновесного массопереноса // Физика и техника полупроводников. 1998. Т. 32, № 5, С. 527—533. [Baizer M. V. // Fizika i Tekhnika poluprovodnikov. 1998. Vol. 32. N 5. P. 527]
- 10. Еремеев С. В., Коротеев Ю. М., Чулков Е. В. Влияние атомного состава поверхности на электронные поверхностные состояния в топологическихизоляторах $A_2^{\ V}B_3^{\ VI}$ // Письма в ЖЭТФ.— 2010.— Т. 91, вып. 8.— С. 419—423. [Eremeiev S. V. // Pis'ma v ZhETF. 2010 Vol. 91. N 8. P. 419]
- 11. Alpichshev Zh., Analytis J. G., Chu J.-H. et al. STM imaging of a bound state along a step on the surface of the topological insulator Bi, Te₃ // http://arxiv.org/abs/1003.2233v1.
- 12. Seo J., Roushan P., Beidenkopf H. et al. Transmission of topological surface states through surface barriers // Nature.—2010.—Vol. 466.— P. 343—346. http://www.nature.com (doi: 10.1038/nature09189).
- 13. Ran Y., Zhang Y., Vishwanath A. Helical Metal Inside a Topological Band Insulator // Nature Physics.— 2009.— Vol. 5.— P. 298—303. http://arxiv.org/abs/0810.5121v1.
- 14. Коржуев М. А. О природе химической связи между слоями в сплавах типа ${\rm Bi}_2{\rm Te}_3//{\rm C6}$. докл. VI Межгосударственного семинара «Термоэлектрики и их применения».— Россия, г. С.-Петербург.— 2002.— С. 139. [Korzhuiev M. A. // Sb. dokl. VI Mezhgosudarstvennogo seminara «Termoelektriki i ikh primeneniya». Russia. St. Petersburg. 2002. P. 139]

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

- ▶ Повышение помехоустойчивости бинаризации изображений фотошаблонов в пространстве вейвлет-преобразования (Украина, г. Одесса)
- Проектирование цифровых фильтров с независимым управлением фазочастотной характеристикой (Россия, г. Тольятти)
- Фоторефрактивные кристаллы в запоминающих устройствах оптоэлектронных процессоров корреляционного типа (Украина, г. Донецк)
- Математическая модель процесса избыточных измерений при непрерывном воздействии измеряемой физической величины на чувствительный элемент датчика (Украина, г. Киев)
- Сшивка полигонов на двухслойной печатной плате (Россия, г. Санкт-Петербург)
- Формирование полированной поверхности халькогенидов висмута и сурьмы (Украина, г. Киев)
- Модель алмазного СВЧ-транзистора (Россия, г. Фрязино)
- Исследование допустимой импульсной мощности кремниевой p^+-p-n^+ -структуры от частоты импульса (Узбекистан, г. Ташкент)
- Метод определения радиационной стойкости интегральных схем с помощью низкоэнергетичного рентгеновского излучения (Украина, г. Киев)
- Природа переходов и механизмы генерации в лазерах с электронной накачкой на основе оптически однородных, радиационно легированных кристаллов CdS (Германия, г. Штутгарт)
- Измерительный преобразователь, индифферентный к хаотическому возбуждению чувствительного элемента (Беларусь, г. Минск)



- Реализация и исследование непрерывной и импульсной синхронизации работы генераторов Чуа (Украина, г. Черновцы)
- Многозондовое подключающее МЭМС-устройство для контроля компонентов с матричными шариковыми выводами (Украина, г. Харьков, г. Львов)
- Система искусственного интеллекта технической диагностики фотошаблонов (Украина, г. Одесса)
- в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции